







Techniques d'analyse en Electroluminescence



Réalisé par :

Niemat Moultif

Encadré par :

Eric Joubert Olivier Latry





Plan

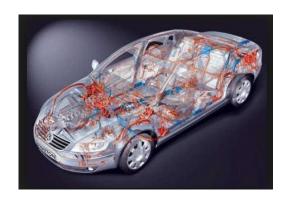
- Contexte
- Principe de la photoémission
- Analyse spectrale en photoémission
- Méthodologie
- Résultats & Tests
- Perspectives



Contexte

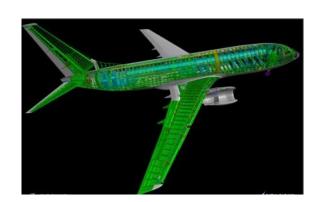
Objectif FIRST

Développement d'une **méthodologie d'analyse de défaillance** des composants **critique** de FIRST



Moyens Instrumentaux du laboratoire

Microscope à émission de photons





Contexte de la thèse : Analyse de défaillance

Du composant à la structure interne ...

Caractérisation électrique des composants

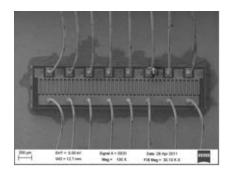


Vieillissement en conditions opérationnelles

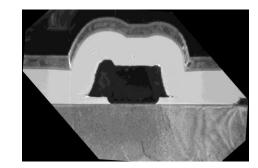


Ouverture par voie laser ou chimique

Microscopie à photoémission, OBIRCH



Analyse microstructurale FIB, MET, SAT

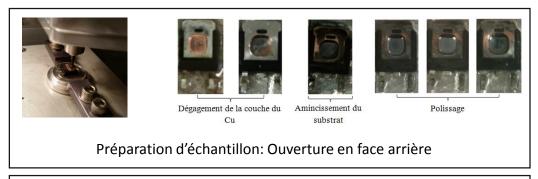


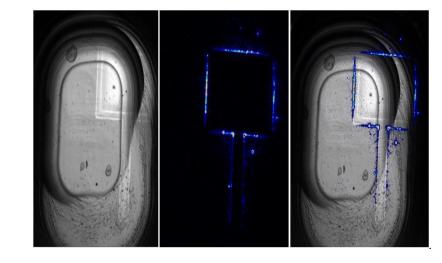
- OBIRCH: Optical Beam Induced Resistance Change
- FIB: Focused Ion Beam
- TEM: Transmission electron microscopy
- SEM: Scanning electron microscopy

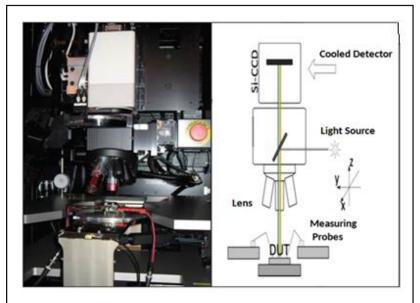


Electroluminescence: principe

La microscopie à émission de photons (PEM) est une technique non destructive pour la localisation de défauts sur composants actifs.







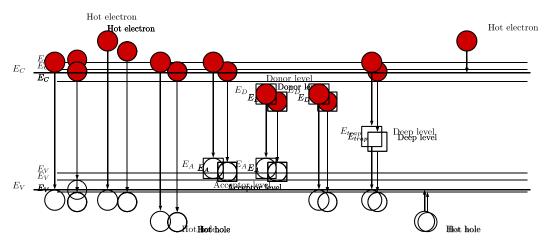
PHEMOS 1000

- Lentilles: Macro 0.8x, NIR 5x, NIR 20x, HighNA 50X, NIR 100X
- Si-CCD Haute Sensibilité : 1024 x 1024

Centre Français Fiabilité



Electroluminescence – Origine



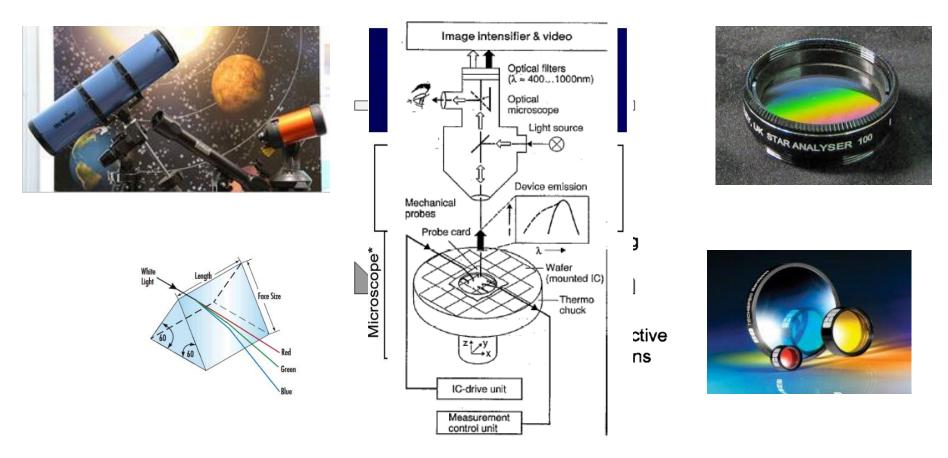
Les différentes transitions possibles avec l'émission de lumière

Classification des différents types d'émission de lumière:

- Les émissions qui sont dues à des défauts ou des défaillances dans le dispositif: (Les défauts de jonction, fuite d'oxyde ...) [1]
- Les émissions qui sont dues au fonctionnement normal du DUT selon les conditions de test :(Grille flottante, Transistor saturé....)
- Les émissions qui ne sont pas détectables
- Les défauts qui n'émettent pas



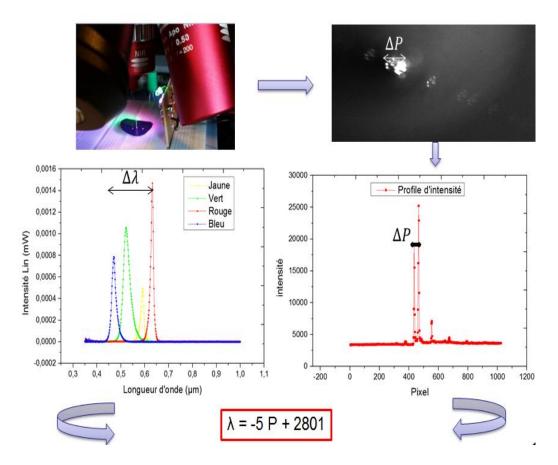
Electroluminescence – Approche spectrale



Insersion d'autrés par le principal de la company de la co

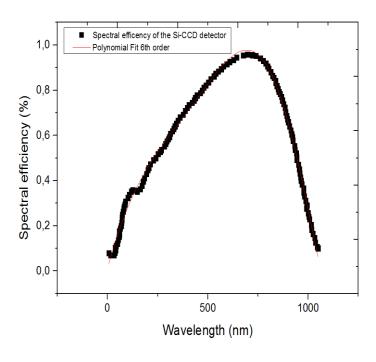


Electroluminescence - Calibration



Relation entre la longueur d'onde et la position x

Utilisation des Leds calibrées → calibration spectrale

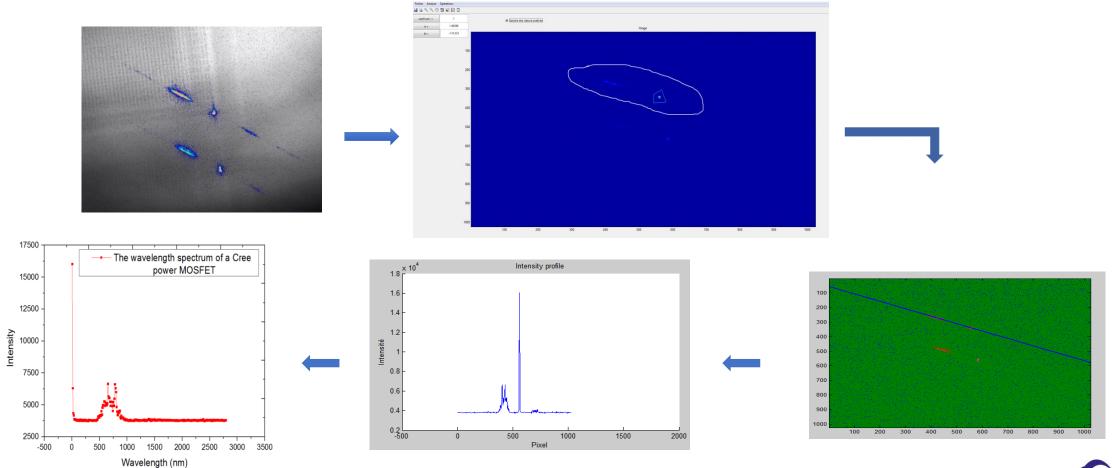


=> Corrigé = Phemos / réponse Du SI-CCD

Correction de l'intensité avec la réponse spectrale du détecteur SI-CCD



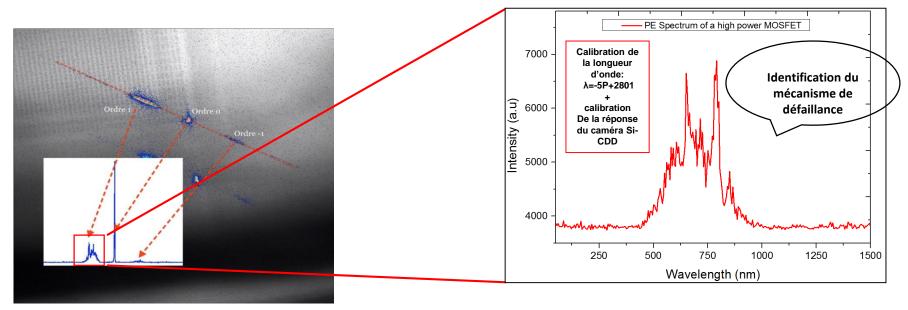
Electroluminescence – Spectrum Extraction



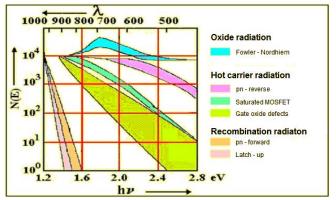
Extraction automatisée \rightarrow Éviter les erreurs dépendant de l'opérateur



Analyse spectrale en PE: Méthodologie



Chaque mécanisme de défaillance (causé par: la faible épaisseur d'oxyde, porteurs chauds, fuite de jonction...) est caractérisé par une enveloppe spectrale spécifique [1].

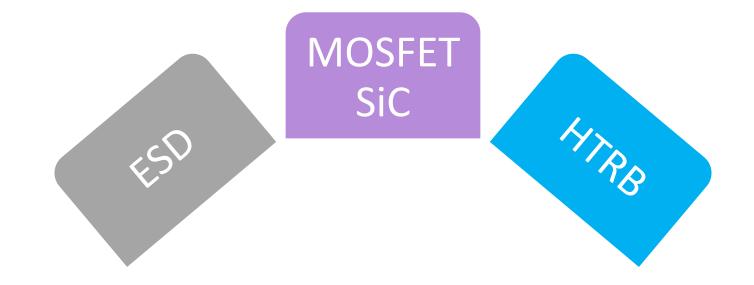




Application: MOSFET SiC



Maximum rating Vds=1200V Ids=19A





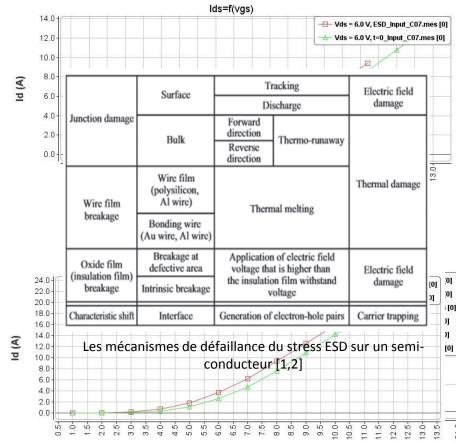
Application 1: Stress ESD



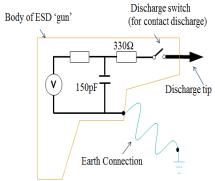
Maximum rating Vds=1200V Ids=19A



C07: Caractéristique d'entrée



Vqs (V)

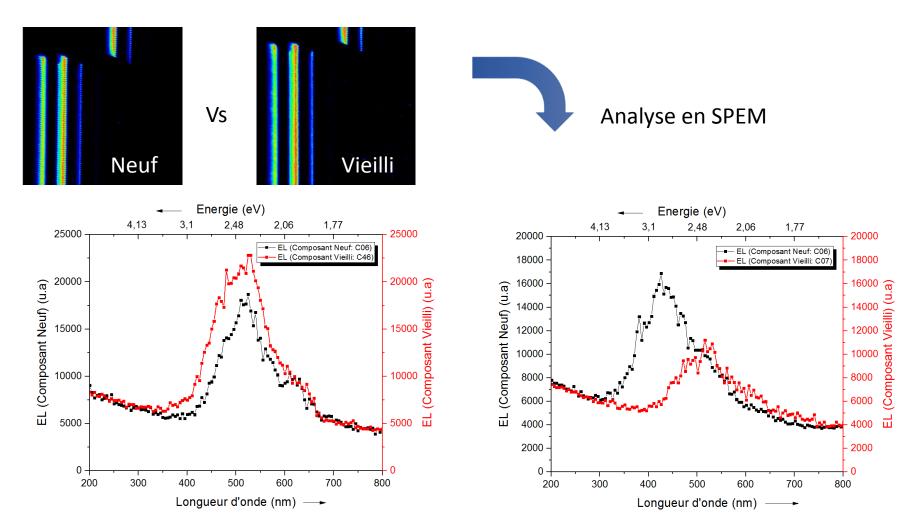


Connection			Tir à	8 KV	Tir à 6 KV	
			C04	C07	C46	C48
	Rds (on) (mΩ)	Neuf	407	408	237	237
		Après Stress ESD	374	373	231	220
	Vth (V)	Neuf	3,152	3,18	2,0835	2,006
		Après Stress ESD	2,85	2,93	1,197	1,771
	ldss (A)	Neuf	4E-10	1,2E-8	8,03159E-10	7,09624E-10
		Après Stress ESD	2 E-9	3,3E-6	2,12173E-5	6,2117E-9

Stress ESD:

- ⇒ Baisse de la résistance à l'état passant
- ⇒ Augmentation du courant de saturation
- ⇒ Baisse de la tension de seuil
- ⇒ Augmentation du courant de fuite

Application 1: Stress ESD: Analyse en SPEM







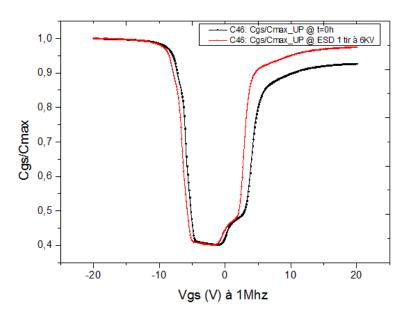


Application 1: Stress ESD: Analyse en C-V



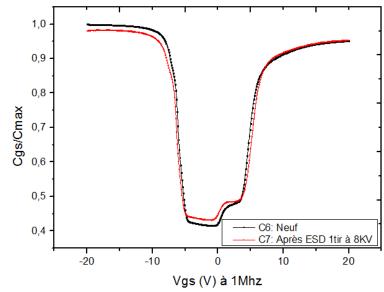
Centre Français Fiabilité

Maximum rating Vds=1200V Ids=19A



- ⇒ Augmentation de la capacité sous le caisson N + et un shift de la pente côté N.
- Diminution de la tension bande plat e V_{fb}
- Diminution de la concentration de dopant de type donneur N_D.
- ⇒ Présence de charges positives dans l'oxyde côté caisson N

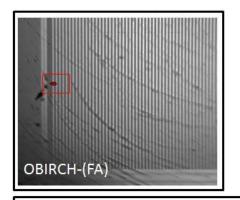
Dégradation de l'oxyde

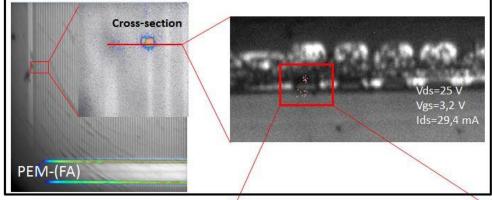


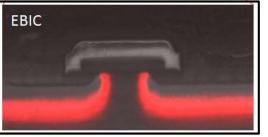
- Baisse de la capacité sous le caisson P.
- Décroissance de la quantité de charge à l'interface Oxyde-Caisson P.
- Baisse de la concentration des dopants de type accepteur Na.
- Diminution de la hauteur de barrière entre le caisson P et le caisson N.
- ⇒ Décalage spectral dans le sens des longueurs d'onde croissant



Application 1: Stress ESD





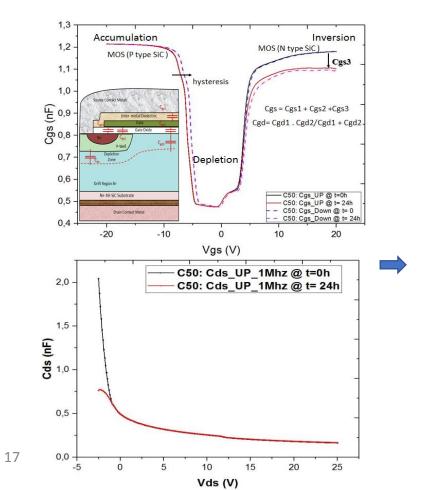




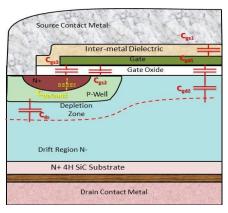
Application2: Stress HTRB

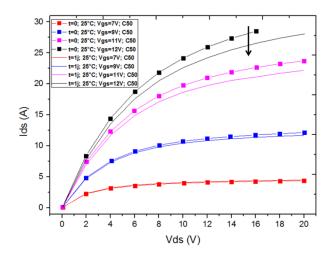
> HTRB : Température constante = 150°C

Vgs=0V Vds= 1100V



HTRB (Vds=1100V)	V _{th} (V) t=0	V _{th} (V) t=1j	$R_{ds}(on) m\Omega$ t=0	R _{ds} (on) mΩ t=1j	I _{dss} (nA) t=0	I _{dss} (pA) t=1j
C50	2.256	2.153	262.5	287.5	0.872	52.9
		→	_			\rightarrow

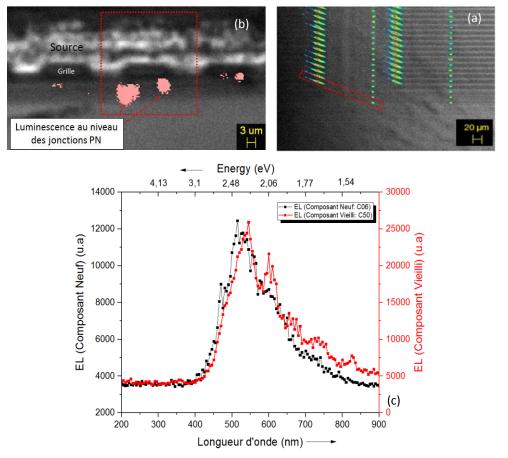


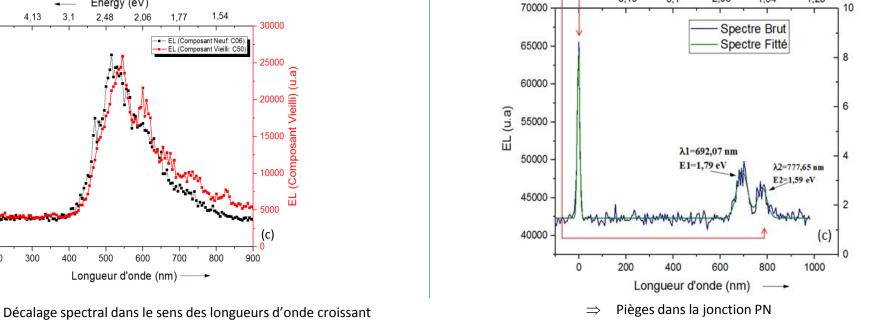


Centre Français Fiabilité

Dégradation de la jonction PN

Application 2: Stress HTRB





Ordre 1

Ordre 0

Ligne de 🤨

Diffraction

Spot en dessous de la grille

côté source

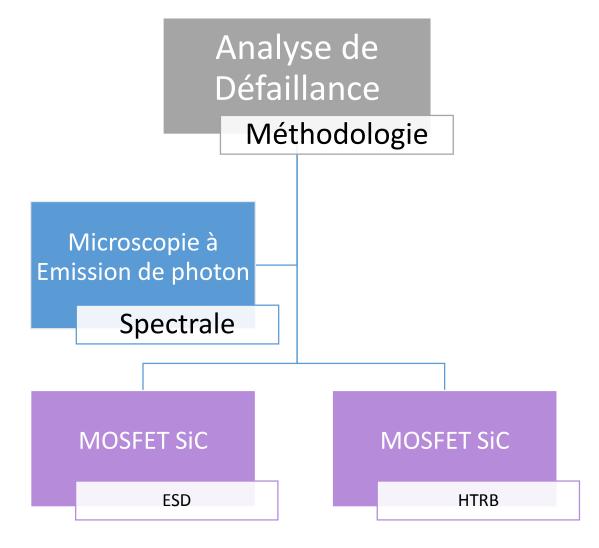
1,23

Energie (eV)





Conclusion

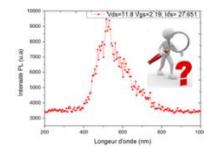




Conclusion

Analyse spectrale en photoémission

- Approche originale
- Processus non destructif le composant fonctionne toujours après mesure
- Complémentaire aux méthodes destructives comme FIB / MEB / ATP
- Nécessite un accès à la zone actif du composant
- Exige une comparaison avec un composant de référence
- Les défauts doivent être de type émissifs.
- Exige une bonne interprétation des spectres



=> Construire une base de donnée qui corrèle la longueur d'onde et les mécanismes de défaillance.

